

(43) 国際公開日 2004 年9 月16 日 (16.09.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/078740 A1

(51) 国際特許分類7: C07D 301/12, 303/04, B01J 29/89

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/002759

(22) 国際出願日:

2004年3月4日(04.03.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-059602 2003 年3 月6 日 (06.03.2003)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友化学 工業株式会社 (SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED) [JP/JP]; 〒5418550 大阪府大阪市中央区北 浜四丁目 5 番 3 3 号 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 阿部川 弘明 (ABEKAWA, Hiroaki) [JP/JP]; 〒2600021 千葉県千葉市 中央区新宿 1 - 2 3 - 8 Chiba (JP). 石野 勝 (ISHINO, Masaru) [JP/JP]; 〒2990245 千葉県袖ヶ浦市蔵波台 2 - 1 8 - 9 Chiba (JP).
- (74) 代理人: 榎本 雅之、 外(ENOMOTO, Masayuki et al.); 〒5418550 大阪府大阪市中央区北浜四丁目 5番3 3号 住友化学知的財産センター株式会社内 Osaka (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

-- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

Al

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING PROPYLENE OXIDE

(54) 発明の名称: プロピレンオキサイドの製造方法

(57) Abstract: A process for producing propylene oxide, characterized by reacting propylene with hydrogen peroxide in the presence of a crystalline titanosilicate catalyst having a pore structure not smaller than the 12-oxygen-membered ring in a nitrile solvent comprising water and a nitrile compound in a proportion of from 0/100 to 20/80 by weight.

○ (57) 要約: 酸素 1 2 員環以上の細孔構造を持つ結晶性チタノシリケート触媒の存在下、水/ニトリル化合物の重量 比が 0 / 1 0 0 ~ 2 0 / 8 0 であるニトリル溶媒中でプロピレンと過酸化水素を反応させることを特徴とするプロピレンオキサイドの製造方法。

BEST AVAILABLE COPY

WO 2004/078740 PCT/JP2004/002759

1

明 細 書

プロピレンオキサイドの製造方法

5 技術分野

本発明はエポキシ化触媒存在下に過酸化水素とプロピレンを反応させることによりプロピレンオキサイドを製造する方法に関するものである。

背景技術

10 酸素12員環以上の細孔構造を持つ結晶性チタノシリケートをエポキシ化触媒として、ニトリル化合物を溶媒に用いて、プロピレンと過酸化水素を反応させ、プロピレンオキサイドを製造する方法としては、アセトニトリルと水が重量比で1:1の溶媒中で酸素12員環の細孔構造を持つTi-MWW触媒を用いる方法が知られている。(例えば平成13年度次世代化学プロセス技術開発・ノンハロゲン化学プロセス技術開発成果報告書168-210、(2002))

一般に活性を高くすることにより、触媒量を減らして触媒コストを下げたり、反応器を小さくして反応器のコストを下げたり、より高い生産性を得ることができる。 そのため、より高い活性でプロピレンオキサイドを得ることができる方法の開発が望まれていた。

20

発明の開示

本発明は過酸化水素を媒体としてプロピレンのエポキシ化反応を行うことによりプロピレンオキサイドを製造する方法であって、効率的にプロピレンオキサイドを製造する方法を提供することにある。

25 すなわち、本発明は酸素12員環以上の細孔構造を持つ結晶性チタノシリケート エポキシ化触媒の存在下、水/ニトリル化合物の重量比が0/100~20/80 であるニトリル溶媒中でプロピレンと過酸化水素を反応させることを特徴とする プロピレンオキサイドの製造方法に係るものである。

発明の実施するための形態

本発明においては酸素12員環以上の細孔構造を持つ結晶性チタノシリケートをエポキシ化触媒として用いる。酸素10員環の細孔構造を持つTS-1触媒のように酸素12員環より狭い細孔構造しか持たない結晶性チタノシリケートでは、本発明の効果は十分に得られない。

結晶性チタノシリケートとはゼオライト構造を有するチタノケイ酸塩であり、代表的な酸素12員環以上の細孔構造を持つ結晶性チタノシリケートとしては、国際ゼオライト学会のゼオライト構造コードで、MTW構造を有する結晶性チタノシリケート(Ti-ZSM-12)(12員環)、BEA構造を有する結晶性チタノシリケート(Ti-MWW)(12員環)、MWW構造を有する結晶性チタノシリケート(Ti-MWW)(12員環)、DON構造を有する結晶性チタノシリケート(Ti-MWW)である。なお、本発明における酸素12員環以上の細孔構造とは、細孔の入口が酸素12員環以上の細孔構造のことであり、本発明におけるプロピレンと過酸化水素の反応においては細孔の入口の大きさが重要である。

本発明に用いられるニトリル溶媒は、水/ニトリル化合物の重量比が 0 / 1 0 0 ~ 2 0 / 8 0 の溶媒である。ニトリル化合物としては、アセトニトリル、プロピオニトリル等があげられ、好ましくはアセトニトリルである。

20 また、ニトリル溶媒は水、ニトリル化合物以外の化合物を含むことが可能である。水、ニトリル化合物以外の化合物としては、アルコール、ケトン化合物、エーテル化合物、エステル化合物、炭化水素、ハロゲン化炭化水素、アミド化合物、グリコール類化合物等の有機化合物があげられる。また、溶媒をリサイクルするために、プロピレングリコール等の副生成物を含むことも可能である。ニトリル化合物に対する水およびニトリル化合物以外の化合物との合計の重量比は、(水+ニトリル化合物以外の化合物)/ニトリル化合物が0/100~50/50が好ましく、0/100~20/80が更に好ましい。

過酸化水素の供給方法としては、予め製造した過酸化水素水を供給する方法、あるいは水素および酸素から系中で過酸化水素を合成して供給する方法等があげら

WO 2004/078740 PCT/JP2004/002759

3

れる。反応系内で過酸化水素を合成する方法としては、水素および酸素から、系内でPd、Au等の過酸化水素を合成する遷移金属触媒をTi-MWW触媒に担持或いは混合して使用することにより、過酸化水素を合成する方法があげられる。水素および酸素から、系内で過酸化水素を合成する方法は、予め過酸化水素水を製造するための設備が不要なため、簡略な設備でプロピレンオキサイドを製造できるという長所を持つ。予め製造した過酸化水素溶液を供給する場合、過酸化水素溶液中の過酸化水素の濃度は0.1~70重量%が一般的である。また、過酸化水素溶液としては、過酸化水素水溶液あるいは過酸化水素、水、有機溶媒の混合溶液があげられる。

10 プロピレンと過酸化水素の反応方法としては、固定床連続流通反応方式あるいは スラリー連続反応方式、回分反応方式があげられるが、回分反応方式より固定床連 続流通反応方式やスラリー連続反応方式のような連続反応方式の方が連続的に生 産できるため効率的にプロピレンオキサイドを製造することができる。

反応器としては、上記反応方式に応じて固定床流通反応器、スラリー反応器等が一般に用いられる。また、これらの反応器においては、反応温度の制御のため交換を行いながら反応することもできる。熱交換の方法としては多管式反応器を用いる方法等があげられる。

エポキシ化反応は、通常0℃ないし150℃の温度、通常大気圧ないし20MP aの圧力下で行われる。

20

15

実施例

次に、実施例により本発明を説明する。

実施例1

Chemistry Letters 774, (2000) に記載の方法に従い調製した I CP発光分析によるTi 含量が1.1重量%のTi -MWW触媒を用いて反応を行った。すなわち、約 $36\%H_2O_2$ 水溶液9.83gとアセトニトリル60.0gと純水3.00gをよく混合した。 H_2O_2 : 濃度の分析値は4.8重量%であった。水の濃度の計算値は12.8重量%、アセトニトリルの計算値は82.4重量%であった。調製した溶液の水/アセトニトリルの重量比は、13/87と

4

なった。この調製した溶液 12gと粉砕した Ti-MWW 触媒 0.010g を 50 m 1 ステンレスオートクレーブに充填した。

次にオートクレーブを氷浴上に移し、液化プロピレン10gを充填した。さらに窒素で2MPa-Gまで昇圧した。オートクレーブを40℃のアルミニウム製ブロックバスに入れ、40℃で反応を行った。内温がおよそ35℃になる5分後を反応開始とした。反応開始1h後、オートクレーブをブロックバスから取り出し、サンプリングを行った。サンプリング時の反応圧力は3MPa-Gであった。得られたサンプルは、ガスクロマトグラフィを用いて分析を行なった。その結果、単位触媒重量あたりのプロピレンオキシド生成活性は $0.470mo1\cdot h^{-1}\cdot g^{-1}$ であった。

実施例2

約3.6% H_2 O_2 水溶液 2.7 O_3 C_4 C_5 C_5 C_6 $C_$

その結果、単位触媒重量あたりのプロピレンオキシド生成活性は、0.463m ol· h^{-1} · g^{-1} であった。

20

25

15

10

比較例1

比較例2

5

約36%H₂O₂水溶液385.5gとアセトニトリル473.4gと純水139.7gをよく混合しH₂O₂の分析値:5.0重量%、水の計算値:47.6重量%、アセトニトリルの計算値:47.4重量%に調製した溶液を用いた以外、実施例1で使用した触媒を用いて、実施例1と同じ同様に反応を行った。調製した溶液の水/アセトニトリルの重量比は、50.1/49.9であった。その結果、単位触媒重量あたりのプロピレンオキシド生成活性は、0.393mol·h⁻¹·g⁻¹であった。

産業上の利用可能性

10 以上説明したとおり、本発明によれば、効率的にプロピレンオキサイドを製造する方法を提供することができる。

WO 2004/078740 PCT/JP2004/002759

6

請求の範囲

- 1. 酸素 1 2 員環以上の細孔構造を持つ結晶性チタノシリケート触媒の存在下、水/ニトリル化合物の重量比が 0 / 1 0 0 ~ 2 0 / 8 0 であるニトリル溶媒中でプロピレンと過酸化水素を反応させることを特徴とするプロピレンオキサイドの製造方法。
 - 2.酸素 1 2 員環以上の細孔構造を持つ結晶性チタノシリケートが T i MWW である請求の範囲第 1 項記載の方法。
 - 3. ニトリル化合物がアセトニトリルである請求の範囲第1項記載の方法。
- 10 4. 反応に用いられる過酸化水素が、予め過酸化水素水を製造し供給された過酸 化水素である請求項1記載のプロピレンオキサイドの製造方法。
 - 5. 反応に用いられる過酸化水素が、プロピレンと過酸化水素の反応と同じ反応 系内で製造された過酸化水素である請求項1記載のプロピレンオキサイドの製造 方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/002759

A CLASSIFIC Int.Cl	CATION OF SUBJECT MATTER C07D301/12, 303/04, B01J29/89	//C07B61/00			
According to Inte	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
B. FIELDS SE					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ C07D301/12, 303/04, B01J29/89//C07B61/00					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)					
2 Control data o	See constitue aming the international season (mails of c	and only whose presidents, some or to	in assay		
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
X Y	Japan Chemical Innovation Ins Nendo Jisedai Kagaku Process Nonhalogen Kagaku Process Gij Seika Hokokusho, [Online], He 6 Gatsu 7 Nichi, New Energy a Technology Development Organi 168 to 210, [retrieved on Hei 5 Gatsu 25 Nichi], Internet < tech.nedo.go.jp/servlet/Houko Servlet?BARCODE=010000656&db= all references; particularly, 179	Gijutsu Kaihatsu utsu Kaihatsu isei 14 Nen nd Industrial zation, pages sei 16 Nen URL: http://www. kushoDownload n&ZF=1>.,	1-5		
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.					
"A" document do to be of part	gories of cited documents: efining the general state of the art which is not considered icular relevance	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention			
filing date	cation or patent but published on or after the international	"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone			
cited to esta special reaso	ablish the publication date of another citation or other on (as specified)	"Y" document of particular relevance; the c considered to involve an inventive	step when the document is		
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "		combined with one or more other such being obvious to a person skilled in the "&" document member of the same patent f	art amily		
31 May,	ctual completion of the international search ay, 2004 (31.05.04) Date of mailing of the international search report 15 June, 2004 (15.06.04)				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer	· ——-		
Facsimile No.		Telephone No.			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/002759

Category®	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Y	WO 2001/68623 A1 (SOLVAY S.A.), 20 September, 2001 (20.09.01), Particularly, page 1, lines 8 to 16; page 6, example 1 & EP 1265877 A	1-5

発明の風する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' C07D301/12, 303/04, B01J29/89 // C07B61/00

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl⁷ C07D301/12, 303/04, B01J29/89 // C07B61/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献		
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
X	財団法人化学技術戦略推進機構,平成13年度 次世代化学プロセ	1-5
Y	ス技術開発・ノンハロゲン化学プロセス技術開発 成果報告書, [0	1-5
	nline],平成14年6月7日,新エネルギー・産業技術総合開発機構,	
1	P. 168-210, [平成16年5月25日検索], インターネット〈URL: http://	
1	www.tech.nedo.go.jp/servlet/HoukokushoDownloadServlet?BARCODE=0100	
	00656&db=n&ZF=1>.	
	全文献、特に、第187頁~第191頁、第179頁などを参	
	照。	
v	WO 2001/60600 A1 (COLVAY COOTETE AVOIDED) 2007 20 20	
1	WO 2001/68623 A1 (SOLVAY SOCIETE ANONYME) 2001.09.20	1–5

区欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの

電話番号 03-3581-1101 内線 3492

「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 15. 6. 2004 31. 05. 2004 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4 P 3 3 3 7 日本国特許庁 (ISA/JP) 福井 美穂 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	特に、第1頁の第8行~第16行、第6頁の実施例1などを参照。	
	& EP 1265877 A	
	·	
}		
		·

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:		
☐ BLACK BORDERS		
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES		
☐ FADED TEXT OR DRAWING		
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING		
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES		
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS		
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS		
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT		
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY		

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.